

講演分科日程表（分科別）I

武蔵工業大学

大分類分科名	3月22日(水)		3月23日(木)		3月24日(金)		3月25日(土)		3月26日(日)	
中分類分科名	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
本部共通行事										
応用物理学会業績賞・研究分野業績賞授賞式		3-ZQ 20 17:30 ~ 18:10								
第6回応用物理学会業績賞受賞記念講演 / 伊賀健一氏		3-ZN 3 13:15 ~ 14:05								
第6回応用物理学会業績賞受賞記念講演 / 志水隆一氏			5-ZL 3 9:00 ~ 9:50							
第19回応用物理学会講演奨励賞贈呈式	3-ZQ 4 12:00 ~ 13:00									
第7回光・量子エレクトロニクス業績賞(宅間宏賞)受賞記念講演				7-L 2 13:00 ~ 13:35						
第3回光・電子集積技術業績賞(林敏雄賞)受賞記念講演		7-Y 2 13:00 ~ 13:35								
日本光学会総会・光学論文賞授賞式受賞記念講演				5-ZL 19 13:00 ~ 15:05						
第38回応用物理学会スクールA「応用物理が活躍する環境テクノロジーの現状と将来」			7-ZB 14 9:25 ~ 16:30							
第38回応用物理学会スクールB「科学技術の基盤としての標準・基礎定数の研究と教育への導入」					7-ZB 15 10:00 ~ 17:10					
応用物理学会評議員会		3-ZQ 20 16:30 ~ 17:30								
懇親会		14-食堂 20 18:30 ~ 20:00								
1. 放射線・プラズマエレクトロニクス										
関連シンポジウム				8-B 29 13:30 ~ 17:10		6-ZE 31 13:30 ~ 17:45				
1.1 放射線・加速器・原子炉					7-M 34 9:30 ~ 12:30	7-M 34 13:30 ~ 18:30				
1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源	7-ZC 34 9:30 ~ 12:30	7-ZC 34 13:30 ~ 17:15	7-ZC 35 9:30 ~ 12:30	7-ZC 35 13:30 ~ 17:45						
1.3 反応性プラズマの診断と計測					7-ZC 35 9:30 ~ 12:30		7-W 35 9:00 ~ 12:30			
1.4 プラズマ応用プロセス	7-M (ショート) 9:00 ~ 11:50	→ポスター 36 13:00 ~ 15:00								
1.5 プラズマプロセスによるナノテクノロジー									7-ZC 36 9:15 ~ 12:00	7-ZC 36 13:00 ~ 14:45
1.6 プラズマ現象一般							7-ZC 37 9:30 ~ 12:30	7-ZC 37 13:30 ~ 16:30		
1.7 分科内総合講演「プラズマエッチングの限界と展開」	5-ZL 37 9:45 ~ 12:30	5-ZL 37 13:30 ~ 16:45								
1.7 プラズマエッチング			7-ZA 38 9:30 ~ 12:00	7-ZA 38 13:00 ~ 16:15						
2. 計測・制御										
2.1 計測・制御技術	8-K 38 10:30 ~ 13:00	8-K 38 14:00 ~ 17:30								
2.2 精密計測・ナノ計測			8-K 38 10:15 ~ 12:15							
2.3 計測標準			8-K 39 12:15 ~ 13:00	8-K 39 14:00 ~ 18:15						
3. 光										
関連シンポジウム				6-ZF 30 13:00 ~ 17:20		7-ZD 31 13:00 ~ 17:00		5-ZL 33 13:30 ~ 18:00		
3.1 物理光学・光学基礎	8-E 39 9:30 ~ 12:00									
3.2 材料光学		8-E 39 13:00 ~ 17:00								
3.3 機器・デバイス光学	8-D 39 10:00 ~ 13:00	8-D 40 14:15 ~ 16:45								
3.4 計測光学					7-ZD 40 9:30 ~ 12:00		7-ZD 40 9:00 ~ 12:00	7-ZD 40 13:00 ~ 18:00	7-ZD 41 9:00 ~ 12:45	
3.5 情報光学			8-E 41 10:00 ~ 13:00	8-E 41 14:00 ~ 18:30						
3.6 視覚・色彩	7-X (ショート) 11:55 ~ 12:35	→ポスター 41 15:30 ~ 17:30								
3.7 生体・医用光学	7-X (ショート) 9:30 ~ 11:55	→ポスター 41 15:30 ~ 17:30								
3.8 近接場光学	8-C 42 10:00 ~ 13:00	8-C 42 14:00 ~ 17:15	8-D 42 10:00 ~ 13:00	8-D 43 14:00 ~ 17:00						
3.9 光学新領域			8-B 43 10:00 ~ 11:45							
4. 量子エレクトロニクス										
関連シンポジウム					5-ZL 32 9:00 ~ 17:20					
4.1 量子光学・原子光学										
4.2 フォトニックナノ構造・現象	7-L 43 9:30 ~ 12:30	7-L 43 13:30 ~ 16:15	7-L 43 9:00 ~ 12:00	※7-L 44 13:00 ~ 17:20	7-L 44 9:30 ~ 12:30	7-L 44 13:30 ~ 18:00				
4.3 レーザー装置・材料							7-P 45 9:30 ~ 12:30	7-P 45 13:30 ~ 18:15	7-P 45 9:30 ~ 13:00	
4.4 超高速・高強度レーザー							8-E 46 10:00 ~ 12:45	8-E 46 13:45 ~ 18:45	8-E 46 10:00 ~ 13:00	8-E 46 14:00 ~ 16:00
4.5 テラヘルツ全般・非線型光学			7-M 47 9:30 ~ 12:30	7-M 47 13:30 ~ 17:30			7-M 47 9:30 ~ 12:30	7-M 47 13:30 ~ 18:45	7-M 48 9:00 ~ 12:30	7-M 48 13:30 ~ 15:00
4.6 レーザー分光応用・計測							14-P5 48 9:30 ~ 11:30		14-P8 49 9:30 ~ 11:30	
4.7 レーザー・プロセッシング							7-L 49 9:30 ~ 12:30	7-L 49 13:30 ~ 18:00	7-L 49 9:00 ~ 12:00	7-L 50 13:00 ~ 15:00

会場名の前は、号館を表示(例:3-ZQは3号館のZQ会場)
 ※光・量子エレクトロニクス業績賞受賞記念講演あり。
 関連シンポジウム12頁参照。

【講義棟略称】

1号館→1
 3号館→3
 5号館→5
 6号館→6

7号館→7
 8号館→8
 14号館→14
 (体育館)

講演分科日程表 (分科別) II

武蔵工業大学

大分類分科名 中分類分科名	3月22日(水)		3月23日(木)		3月24日(金)		3月25日(土)		3月26日(日)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
5. 光エレクトロニクス										
関連シンポジウム				3-ZN 30 13:00 ~ 17:05		8-D 31 13:30 ~ 17:25				
5.1 半導体レーザー・発光素子	3-ZN 50 9:00 ~ 12:00	※3-ZN 50 13:15 ~ 17:35	3-ZN 50 9:00 ~ 12:00			6-ZK 32 13:00 ~ 18:15				
5.2 光検出									8-D 51 10:00 ~ 12:00	
5.3 光記録					3-ZQ (ショート) 9:00 ~ 10:30	→ポスター 51 13:00 ~ 15:00				
5.4 光制御	7-Y 51 9:00 ~ 12:00	※7-Y 51 13:00 ~ 18:05			7-Y 52 9:30 ~ 12:45		7-Y 52 9:30 ~ 12:30	7-Y 53 13:30 ~ 17:00	7-Y 53 9:30 ~ 12:30	
5.5 光ファイバー						7-Y 53 13:45 ~ 18:15		7-W 52 13:30 ~ 17:45		
6. 薄膜・表面										
関連シンポジウム		7-T 29 13:00 ~ 16:50		6-ZK 30 13:00 ~ 17:35		6-ZG 32 13:30 ~ 17:30				
		6-ZK 29 13:00 ~ 17:20								
		6-ZG 29 13:30 ~ 16:35								
6.1 強誘電体薄膜					7-S 53 9:30 ~ 12:30	7-S 54 13:30 ~ 18:45	7-S 54 9:30 ~ 12:30	7-S 54 13:30 ~ 18:30	7-S 55 9:00 ~ 12:00	7-S 55 13:00 ~ 15:00
6.2 カーボン系薄膜	6-ZG 55 9:00 ~ 12:30		7-Q 55 9:00 ~ 12:00	7-Q 55 13:00 ~ 18:30	7-Q 56 9:00 ~ 12:00	7-Q 56 13:00 ~ 18:15				
6.3 酸化エレクトロニクス	14-P1 56 9:30 ~ 11:30		14-P3 57 9:30 ~ 11:30		14-P4 58 9:30 ~ 11:30					
6.4 薄膜新材料	7-R 59 9:30 ~ 12:30	7-R 59 13:30 ~ 17:30	7-R 59 9:30 ~ 12:30	7-R 59 13:30 ~ 19:00	7-R 60 9:30 ~ 12:30					
6.5 表面物理・真空	7-T 60 9:00 ~ 12:00		7-T 60 9:30 ~ 12:30	7-T 60 13:30 ~ 19:00	7-T 61 9:30 ~ 12:30					
6.6 プローブ顕微鏡						7-R 61 13:30 ~ 18:45	7-R 61 9:30 ~ 12:30	7-R 62 13:30 ~ 18:30	7-R 62 9:30 ~ 13:00	
7. ビーム応用										
関連シンポジウム								8-C 33 13:00 ~ 17:45		
7.1 X線技術					8-E 62 9:30 ~ 12:45	8-E 62 13:45 ~ 18:00	3-ZQ 63 9:00 ~ 11:30			
7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析			※5-ZL (ショート) 9:00 ~ 11:50	→ポスター 63 13:00 ~ 15:00						
7.3 リソグラフィ							7-ZB 64 9:30 ~ 12:30	7-ZB 64 13:30 ~ 18:00	7-ZB 64 9:30 ~ 12:30	
7.4 ナノインプリント						8-F 64 14:00 ~ 18:15				
7.5 ビーム・光励起表面反応	8-F 65 10:00 ~ 12:15	8-F 65 13:15 ~ 16:15								
7.6 イオンビーム一般			8-F 65 10:00 ~ 13:00	8-F 65 14:00 ~ 18:45	8-F 66 10:00 ~ 13:00					
7.7 微小電子源							8-F 66 9:00 ~ 12:00	8-F 66 13:00 ~ 19:00		
7.8 ビーム応用一般・新技術									8-F 67 10:00 ~ 12:15	8-F 67 13:15 ~ 14:45
8. 応用物性										
8.1 磁性材料・磁気デバイス	8-G 67 10:00 ~ 12:45	8-G 67 14:00 ~ 17:15								
8.2 誘電材料・誘電体							14-P6 67 9:30 ~ 11:30		14-P9 68 9:30 ~ 11:30	
8.3 微粒子・粉体			8-G 68 10:00 ~ 12:45	8-G 68 14:00 ~ 17:45						
8.4 ナノエレクトロニクス					8-G 68 10:00 ~ 12:45	8-G 68 14:00 ~ 17:45				
8.5 熱電変換							8-G 69 10:00 ~ 11:30	8-G 69 13:00 ~ 17:45	8-G 69 9:00 ~ 12:00	
8.6 新機能材料・新物性							8-H 69 10:00 ~ 13:30			
9. 超伝導										
関連シンポジウム				6-ZE 30 13:30 ~ 18:00						
9.1 基礎物性					8-H 70 9:00 ~ 12:00	8-H 70 13:00 ~ 18:45				
9.2 新材料, 新薄膜, 新低温動作デバイス	8-H (ショート) 9:00 ~ 9:35	→ポスター 70 13:00 ~ 15:00								
9.3 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長							8-K 71 9:15 ~ 12:00	8-K 71 13:00 ~ 17:00		
9.4 臨界電流, 超伝導パワー応用					8-K 71 10:00 ~ 13:00	8-K 71 14:00 ~ 18:30				
9.5 アナログ応用および関連技術		7-M 72 12:45 ~ 17:45	8-H 72 10:00 ~ 13:00							
9.6 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	8-H 72 10:00 ~ 12:00	8-H 72 13:00 ~ 17:45								

会場名の前は、号館を表示 (例: 3-ZN は 3号館の ZN 会場)
 ※第 6 回応用物理学会業績受賞記念講演あり。
 ※※光・電子集積技術業績受賞記念講演あり。
 関連シンポジウム 12 頁参照。

【講義棟略称】

1号館→1
 3号館→3
 5号館→5
 6号館→6

7号館→7
 8号館→8
 14号館→14
 (体育館)

講演分科日程表 (分科別) III

武蔵工業大学

大分類分科名	3月22日(水)		3月23日(木)		3月24日(金)		3月25日(土)		3月26日(日)	
中分類分科名	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
10. 有機分子・バイオエレクトロニクス										
関連シンポジウム				6-ZG 30 13:00 ~ 17:45	5-ZL 32 9:00 ~ 17:20			6-ZK 33 13:00 ~ 18:00		
						8-C 31 13:00 ~ 17:25				
						3-ZP 32 13:00 ~ 17:25				
10.1 作製技術	7-N 73 9:30 ~ 12:30	7-N 73 13:30 ~ 17:30	7-N 73 9:30 ~ 12:30	7-N 74 13:30 ~ 18:15	7-N 74 9:30 ~ 12:30	7-N 74 13:30 ~ 18:15				
10.2 評価・基礎物性							7-N 75 9:00 ~ 12:00	7-N 75 13:00 ~ 18:45	7-N 75 9:00 ~ 12:00	7-N 76 12:45 ~ 15:00
10.3 電子機能材料・デバイス	7-S 76 9:30 ~ 12:30	7-S 76 13:30 ~ 18:00	7-S 76 9:30 ~ 12:30	7-S 76 13:30 ~ 19:00						
10.4 光機能材料・デバイス							7-Q 77 9:30 ~ 12:30	7-Q 77 13:30 ~ 18:15	7-Q 77 9:00 ~ 12:00	7-Q 78 13:00 ~ 15:00
10.5 液晶		7-P (ショート) 13:30 ~ 14:40 →ポスター 78 15:30 ~ 17:30	7-P (ショート) 9:40 ~ 11:30	→ポスター 78 13:00 ~ 15:00						
10.6 高分子・ソフトマテリアル					8-D (ショート) 10:00 ~ 11:15	→ポスター 78 13:00 ~ 15:00				
10.7 生物・医用工学・バイオチップ						1-I 79 13:00 ~ 17:45	1-I 79 9:00 ~ 12:00	1-I 79 13:00 ~ 18:00	1-I 80 9:00 ~ 12:00	
10.8 有機EL						6-ZK 80 9:00 ~ 12:00	6-ZK 80 9:00 ~ 12:00	6-ZK 80 9:00 ~ 12:00	6-ZK 80 9:00 ~ 12:00	6-ZK 81 13:00 ~ 14:30
10.9 特定テーマA:有機トランジスタ	6-ZK 81 9:00 ~ 12:00		6-ZG 81 9:00 ~ 12:00		6-ZG 81 9:00 ~ 12:00		6-ZG 81 9:00 ~ 12:00	6-ZG 82 13:00 ~ 19:15	6-ZG 82 9:00 ~ 12:00	6-ZG 82 9:00 ~ 12:00
10.10 特定テーマB:生体分子計測・バイオナノテク/ロジック	1-I 83 9:00 ~ 12:00	1-I 83 13:00 ~ 18:00	1-I 83 9:00 ~ 12:00		1-I 83 9:00 ~ 12:00					
11. 半導体A (シリコン)										
関連シンポジウム		7-ZA 29 10:00 ~ 16:35					6-ZF 31 13:00 ~ 17:50			
11.1 基礎物性・評価	7-V 84 9:30 ~ 12:30	7-V 84 13:30 ~ 17:00	7-V 84 9:30 ~ 12:30							
11.2 半導体表面								14-P7 85 9:30 ~ 11:30		14-P10 85 9:30 ~ 11:30
11.3 絶縁膜技術				7-V 85 13:30 ~ 19:00	7-V 85 9:30 ~ 12:30	7-V 86 13:30 ~ 18:45	7-V 86 9:30 ~ 12:30	7-V 86 13:30 ~ 19:00	7-V 87 9:30 ~ 12:30	
11.4 分科内総合講演「Cu/low-k多層配線技術の現状と今後の課題」			8-C 87 10:00 ~ 17:45							
11.4 配線技術					8-J 87 10:00 ~ 13:00	8-J 88 14:00 ~ 18:30	8-J 88 9:00 ~ 13:00			
11.5 Si プロセス技術	7-W 88 9:30 ~ 12:30	7-W 89 13:30 ~ 17:15	7-W 89 9:30 ~ 12:30	7-W 89 13:30 ~ 18:00	7-W 89 9:00 ~ 12:30	7-W 90 13:30 ~ 17:45				
11.6 Si デバイス/集積化技術			7-X 90 9:30 ~ 12:30		7-X 90 9:30 ~ 12:30	7-X 90 13:30 ~ 18:45	7-X 91 9:30 ~ 12:30	7-X 91 13:30 ~ 19:00	7-X 92 9:00 ~ 12:00	7-X 92 13:00 ~ 15:00
11.7 シミュレーション				7-X 92 13:30 ~ 17:30						
12. 半導体B (探索的材料・物性・デバイス)										
関連シンポジウム				3-ZM 30 13:10 ~ 17:30		8-C 31 13:00 ~ 17:25	6-ZF 33 9:00 ~ 17:45			
12.1 探索的材料物性							8-D 92 10:00 ~ 13:00	8-D 93 14:00 ~ 18:30	8-C 93 9:00 ~ 12:00	#8-C 93 13:00 ~ 14:45
12.2 超薄膜・量子ナノ構造					8-B 93 10:00 ~ 13:00	8-B 93 14:00 ~ 19:00	8-B 94 10:00 ~ 13:00	8-B 94 14:00 ~ 19:00		
12.3 プロセス技術・界面制御	8-B 94 10:30 ~ 13:00	#8-B 95 14:00 ~ 18:00								
12.4 超高速・機能デバイス			6-ZE (ショート) 9:15 ~ 12:00	→ポスター 95 15:30 ~ 17:30	6-ZE (ショート) 9:30 ~ 11:45	→ポスター 95 15:30 ~ 17:30				
12.5 半導体光物性・光デバイス	1-ZR 96 9:00 ~ 12:00	1-ZR 96 13:00 ~ 17:15	1-ZR 96 9:00 ~ 12:00	#1-ZR 97 13:00 ~ 18:00	1-ZR 97 9:00 ~ 12:00	1-ZR 97 13:00 ~ 17:30	1-ZR 98 9:00 ~ 12:00	6-ZH 98 13:00 ~ 17:45	3-ZN 98 9:15 ~ 11:30	1-ZR 99 13:00 ~ 15:00
								1-ZR 98 13:00 ~ 17:00	1-ZR 99 9:00 ~ 12:00	
13. 結晶工学										
関連シンポジウム						6-ZF 31 13:00 ~ 17:50	6-ZF 33 9:00 ~ 17:45			
						6-ZG 32 13:30 ~ 17:30				
13.1 バルク結晶成長				7-ZD 99 13:30 ~ 18:30						
13.2 II-VI 族結晶	6-ZH 99 9:00 ~ 12:00	6-ZH 100 13:00 ~ 18:00								
13.3 III-V 族エピタキシャル結晶	7-Q 100 9:00 ~ 12:00	7-Q 100 13:00 ~ 13:30			7-P 100 9:00 ~ 12:00	7-P 101 13:00 ~ 18:45	7-T 101 9:00 ~ 12:00	7-T 101 13:00 ~ 18:45		
13.4 III-V 窒化物結晶	6-ZF 102 9:00 ~ 12:00	6-ZF 102 13:00 ~ 17:45	6-ZF 102 9:00 ~ 12:00		6-ZF 103 9:00 ~ 12:00		8-C 103 9:00 ~ 12:00		6-ZE 105 9:00 ~ 12:00	6-ZE 105 13:00 ~ 14:30
	3-ZQ 102 9:00 ~ 11:00		6-ZK 103 9:00 ~ 12:00		6-ZH 103 9:00 ~ 11:30		6-ZE 104 9:00 ~ 11:45	6-ZE 104 13:00 ~ 17:30	6-ZF 105 9:00 ~ 12:00	6-ZF 105 13:00 ~ 15:00
			3-ZQ 103 9:00 ~ 12:00				6-ZL 104 9:00 ~ 12:45			
13.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶	6-ZE 105 9:00 ~ 12:00	6-ZE 106 13:00 ~ 16:15	7-ZD 106 9:30 ~ 12:00							
13.6 IV 族系化合物				3-ZQ (ショート) 13:00 ~ 14:20	3-ZP (ショート) 9:00 ~ 10:45	→ポスター 106 15:30 ~ 17:30				
				→ポスター 106 15:30 ~ 17:30						
13.7 エピタキシーの基礎		7-Q 107 13:30 ~ 17:45								
13.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥	7-ZB 107 9:00 ~ 12:00	7-ZB 107 13:00 ~ 17:45								

会場名の前は、号館を表示 (例: 6-ZG は 6号館の ZG 会場)
 #11. 半導体 A (シリコン) 分科内招待講演あり。
 関連シンポジウム 12 頁参照。

【講義棟略称】

1号館→1
 3号館→3
 5号館→5
 6号館→6

7号館→7
 8号館→8
 14号館→14
 (体育館)

講演分科日程表（分科別）IV

武蔵工業大学

大分類分科名 中分類分科名	3月22日(水)		3月23日(木)		3月24日(金)		3月25日(土)		3月26日(日)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
14. 非晶質・微結晶										
関連シンポジウム		6-ZG 29 13:30 ~ 16:35				5-ZM 32 13:30 ~ 17:00	6-ZF 33 9:00 ~ 17:45			
14.非晶質・微結晶分科内招待講演「薄膜トランジスタ用プラズマ CVD 装置の最近の進展」				7-Y 108 13:30 ~ 14:30						
14.1 基礎物性・評価					7-ZA 108 9:30 ~ 12:15		7-ZA 108 9:15 ~ 12:30	7-ZA 108 13:30 ~ 18:00		
14.2 プロセス技術			7-Y 108 9:00 ~ 12:15	7-Y 109 14:30 ~ 16:15						
14.3 デバイス				7-Y 109 16:30 ~ 18:30						
15. 応用物理一般										
関連シンポジウム				8-A 29 13:30 ~ 16:40		8-A 31 13:00 ~ 16:50	6-ZF 33 9:00 ~ 17:45			
						8-C 31 13:00 ~ 17:25				
15.1 応用物理一般	8-A 109 11:00 ~ 12:45	8-A 109 14:00 ~ 17:15								
15.2 教育			14-P2 109 9:30 ~ 11:30							
15.3 新技術		7-X 110 13:30 ~ 17:30								
15.4 トライボロジー	8-A 110 10:00 ~ 11:00									
15.5 エネルギー変換・貯蔵						8-C 110 9:00 ~ 11:15				
15.6 資源・環境						8-C 110 11:15 ~ 12:00				
15.7 磁場応用									8-A 110 9:00 ~ 12:00	8-A 110 13:15 ~ 15:00
合同セッション										
「合同 E」関連シンポジウム				3-ZM 30 13:10 ~ 17:30						
「合同 F」関連シンポジウム		6-ZK 29 13:00 ~ 17:20								
「合同 K」関連シンポジウム						6-ZG 32 13:30 ~ 17:30				
合同セッション D「プラズマ CVD の基礎と応用」	7-P 111 9:00 ~ 12:30	3-ZP 111 13:30 ~ 17:00								
合同セッション E「スピントロニクス・ナノマグネティクス」	3-ZM 111 9:00 ~ 12:15	3-ZM 111 13:15 ~ 18:15	3-ZM 112 9:00 ~ 12:00		3-ZM 112 9:00 ~ 12:15		3-ZM 112 9:00 ~ 12:15	3-ZM 113 13:15 ~ 19:15	3-ZM 113 9:00 ~ 12:15	3-ZM 113 13:00 ~ 15:00
合同セッション F「カーボンナノチューブの基礎と応用」	3-ZP 114 9:00 ~ 12:00		3-ZP 114 9:00 ~ 12:00	3-ZP 114 13:00 ~ 17:30	3-ZN 114 9:00 ~ 12:00	3-ZN 115 13:00 ~ 17:30	3-ZN 115 9:00 ~ 12:00	3-ZN 115 13:00 ~ 17:30	3-ZQ 116 9:00 ~ 12:00	3-ZQ 116 13:00 ~ 15:15
合同セッション G 分科内総合講演「光子数識別技術の現状と将来展望」		7-ZD 116 13:00 ~ 16:15								
合同セッション G「量子情報の基礎と応用」						7-T 116 13:30 ~ 18:45				
合同セッション K「酸化亜鉛系機能性材料」							3-ZP 117 9:00 ~ 12:00	3-ZP 117 13:00 ~ 17:15	3-ZP 117 9:00 ~ 11:45	3-ZP 117 13:00 ~ 14:45

会場名の前は、号館を表示（例：6-ZG は 6 号館の ZG 会場）
関連シンポジウム 12 頁参照。

【講義棟略称】

1 号館→1
3 号館→3
5 号館→5
6 号館→6

7 号館→7
8 号館→8
14 号館→14
(体育館)

講演分科日程表について

(例)

3月22日(水)		3月23日(木)		3月24日(金)		3月25日(土)		3月26日(日)	
午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
7-M(ショート) 9:00~11:50	→ポスター 36 13:00~15:00	14-P1 56 9:00~11:30	5-ZL 33 13:00~15:00	6-ZG 81 9:00~12:00	6-ZG 81 13:00~18:00	8-A 90 9:00~12:00	8-A 90 13:00~18:00	8-A 110 9:00~12:00	
amがショート講演, pmがポスターセッションの例		ポスターセッションのみ		場所の略記号(5号館, ZL会場)		講演時間		プログラム掲載頁	